磁控溅射镀膜机

产品名称	磁控溅射镀膜机
公司名称	北京维意真空技术应用有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧桥路25号院
联系电话	010-67947887 15611171559

产品详情

1.设备简介

小型磁控溅射镀膜仪,主要特点是设备体积小,结构简单紧凑易于操作,对实验室供电要求低;该系列设备主要部件采用进口或者国内的配置,从而提高设备的稳定性;另外自主开发的智能操作系统在设备的运行重复性及安全性方面得到更好地保障。目前该系列有基本型、旗舰型、豪华型、尊享型4种不同配置可供选择,可以根据客户的不同需求进行配置,比较灵活;标配2只 2英寸永磁靶,一台500W直流溅射电源,主要用来开发纳米级单层及多层的金属导电膜、半导体膜以及绝缘膜等。

2.设备主要优势

- 2.1 实用性:设备集成度高,结构紧凑,占地面积小,可以满足客户实验室空间不足的苛刻条件;通过更换设备上下法兰可以实现磁控与蒸发功能的转换,实现一机多用;
- 2.2 方便性:设备需要拆卸的部分均采用即插即用的方式,接线及安装调试简单,既保证了设备使用方便又保证了设备的整洁;
- 2.3 高性价比:设备主要零部件采用进口或国内知名品牌,以国产设备的价格拥有进口设备的配置,从而保证了设备的质量及性能;

2.4 安全性:独立开发的PLC+触摸屏智能操作系统在传统操作系统的基础上新具备了漏气自检与提示、通讯故障自检、保养维护提示等功能,保证了设备的使用安全性能;

3.主要技术参数

- 3.1 腔室尺寸: 246×228mm, 1Cr18Ni9Ti优质不锈钢材质, 氩弧焊接;
- 3.2 样品台尺寸: 75mm,高度:60~120mm可调,旋转:0-20r/min可调;
- 3.3 真空系统:机械泵(TRP-12,3L/s)+Pfeiffer分子泵(Hipace80,67L/s)(可选国产分子泵);GDC -25b电磁挡板阀,DN25mm 限流阀;
 - 3.4 极限真空: 8.0 × 10-5Pa;
 - 3.5 真空抽速:大气~8×10-4Pa 20min:
 - 3.6 真空测量:全量程复合真空计,测量范围:105Pa~10-5Pa;
 - 3.7 磁控靶: 2英寸2只(含靶挡板),兼容直流电源和射频电源;
 - 3.8 溅射电源: 直流和射频可选;
 - 3.9 质量流量计: 20sccm、50sccm质量流量控制器各一套;
- 3.10控制方式: PLC+触摸屏智能控制系统,具备漏气自检与提示、通讯故障自检、保养维护提示等功能;
 - 3.11设备外形: L60cm x W60cm x H96cm机电一体化机架, 预留1个KF40法兰接口;
 - 3.12 设备供电总功率 2KW, 220V, 单相三线制(一火一零一地);
- 3.13 冷却循环系统:水压0.2~0.4MPa,水温10~25,给设备相关需水冷部件提供稳定的制冷水